

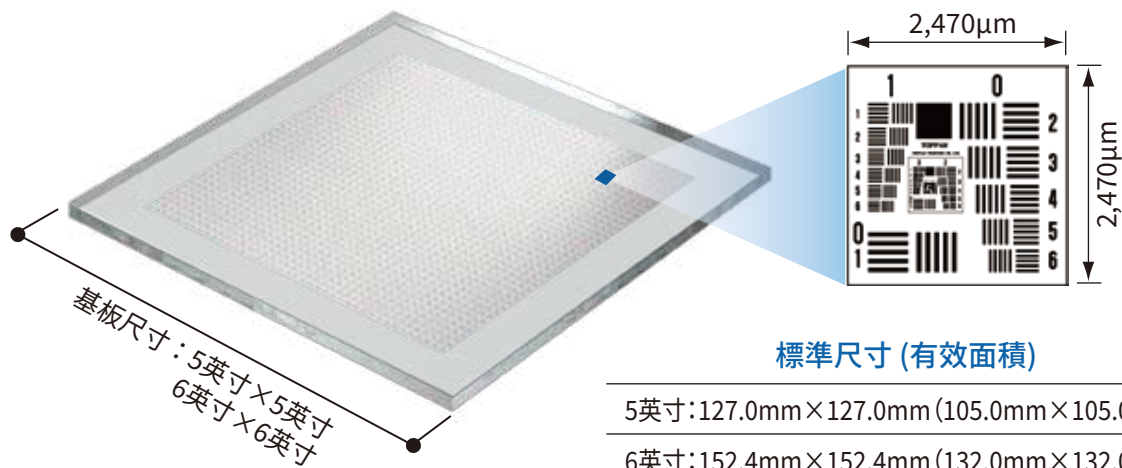
適用於設備品質控制和分辯率確認等應用

凸版印刷測試圖

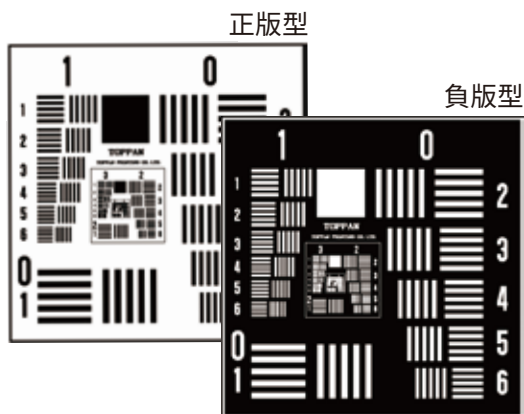
在高純度的玻璃基板上用鉻形成基本形狀圖案的光掩模。

可提供正版型及負版型。

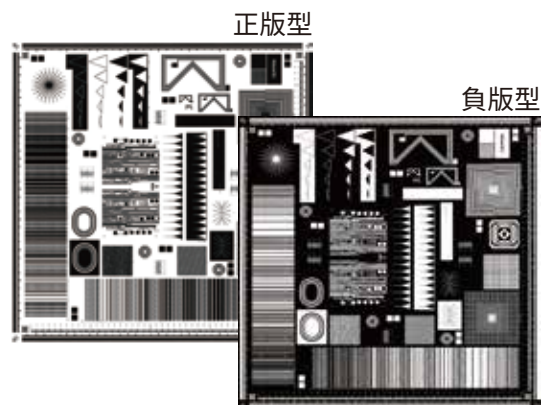
用於裝置的精度控制、分辯率檢查以及選擇光致抗蝕劑時的評估基準等用途。



模式: No.1



模式: No.2



除了上述标准型号外，也可以制作配置客户要求图案的定制型号。

TOPPAN PHOTOMASK CO., LTD.

e-mail : photomask@toppan.co.jp